

Установка плазменной обработки CIONE6-ICP-ЗМР



Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Камера	Прямоугольная алюминиевая камера с дверцей 200×220×160 мм
Объем камеры	7 л.
Газовая система	Цифровые РРГ
Генератор плазмы	Генератор для источника ICP с автоматическим согласованием, Генератор Bias электрода

Режимы работы	Только ICP: очистка, модификация поверхности, плазмохимическое травление, Только Bias: реактивное ионное травление низкой плотности (мягкое травление, ICP + Bias: плазменное травление высокой плотности
Управление	Автоматическое (сенсорный дисплей)
Держатель образцов	Лоток для образцов диаметром 6 дюймов
Датчик давления	Пирани
Вакуумный насос	Безмасляный насос

Описание

Серия **CIONE-ICP** с уникальной конструкцией источника индуктивно-связанной плазмы планарного типа обеспечивает более высокую плотность и неповреждающую плазму, а также обеспечивает высокую производительность направленного травления в сочетании с электродом смещения.

С помощью этого оборудования пользователи могут выборочно выполнять **травление высокой плотности** наряду с удалением нанослоев, называемое «**мягким травлением**», а также модификацию поверхности, такую как придание **гидрофильности, активацию поверхности, очистку и улучшение адгезии.**